

日本知財学会「アジア特許情報の最新動向」

2012年12月8日

アジア・新興国知財情報収集の現状

アジア特許情報研究会
伊藤徹男

アジア・新興国の特許収録の現状

- ・最近では、誰でも気軽に商用英語データベースにアクセスできるようになった。
- ・データベースに収録国として挙げてあれば
特に、研究者・技術者は、データの収録は100%と勘違いする。
実は、収録状況は国ごとに異なる。
- ・商用英語データベースの収録が100%であるのは、
US、EPなど欧米とPCT、日本、中国のみ。
(但し中国は1～2か月のタイムラグあり)
- ・調査前に収録年と収録状況を確認することが重要。

データが欠落していることに気づかないと
「調査しましたがありませんでした。」と報告することになる。

商用英語データベースの蓄積情報

世界 44カ国以上の特許発行機関を対象に 4,350 万以上の特許ドキュメントを網羅し、2,000万件以上のレコードを収録している。他を寄せつけない規模で世界の特許文献にアクセスできます。

業界最多の収録範囲:

100カ国の特許情報を収録。インド・メキシコ・ユーラシア特許が新たに追加され、30カ国のフルテキスト(全クレームを含む全文)を網羅しています。

世界80カ国以上の約5,000万件のデータが横断検索できます。

商用英語データベースでは、収録国数、全収録レコード数を競うかの如くPRしているが...

データの収録に欠落があれば、上記のような情報だけでデータベース採否の判断材料とはならない。

まず収録を確認してから
「**英語データベースの収録には欠落がある**」と認識して使うことが重要

商用英語データベース収録状況(中国)

中国特許の商用英語データベースへの収録は、2,3年で大幅に改善された。

	CNIPR		A社				B社				C社			
	公開	登録	公開抄録		登録抄録		公開抄録		登録抄録		公開抄録		登録抄録	
	書誌	書誌	CN A	収録率	CN B/C/B	収録率	CN A	収録率	CN B/C/B	収録率	CN A	収録率	CN B/C/B	収録率
2005	155446	51494	153917	99%	51139	99%	151299	97%	50862	99%	155353	100%	51462	100%
2006	172428	58368	170551	99%	57895	99%	169998	99%	57267	98%	172319	100%	58327	100%
2007	208347	65771	205497	99%	65292	99%	204751	98%	64769	98%	208265	100%	65723	100%
2008	241182	89937	238982	99%	89309	99%	238202	99%	88903	99%	241120	100%	89871	100%
2009	281006	128649	278551	99%	127382	99%	277559	99%	127595	99%	280936	100%	128507	100%
2010	315836	129809	313605	99%	129198	100%	313088	99%	129153	99%	315780	100%	129731	100%
2011	368434	163948	366104	99%	163181	100%	365622	99%	163347	100%	368196	100%	163890	100%
2012/1	32551	14394	32392	100%	14379	100%	32331	99%	14376	100%	32546	100%	14389	100%
2012/2	31516	13244	31380	100%	13231	100%	31355	99%	13225	100%	31512	100%	13239	100%
2012/3	30390	10286	30283	100%	10276	100%	30215	99%	10271	100%	30383	100%	10283	100%
2012/4	32465	10891	32322	100%	10881	100%	32247	99%	10877	100%	32461	100%	10884	100%
2012/5	56190	26792	55945	100%	26744	100%	55722	99%	26723	100%	56068	100%	26785	100%
2012/6	38807	17713	38698	100%	17681	100%	38728	100%	17660	100%	38802	100%	17705	100%
2012/7	89104	30793	88780	100%	30734	100%	88305	99%	30708	100%	82866	93%	30784	100%

収録タイムラグはデータベースごとに異なる。

商用データベースの収録(台湾)

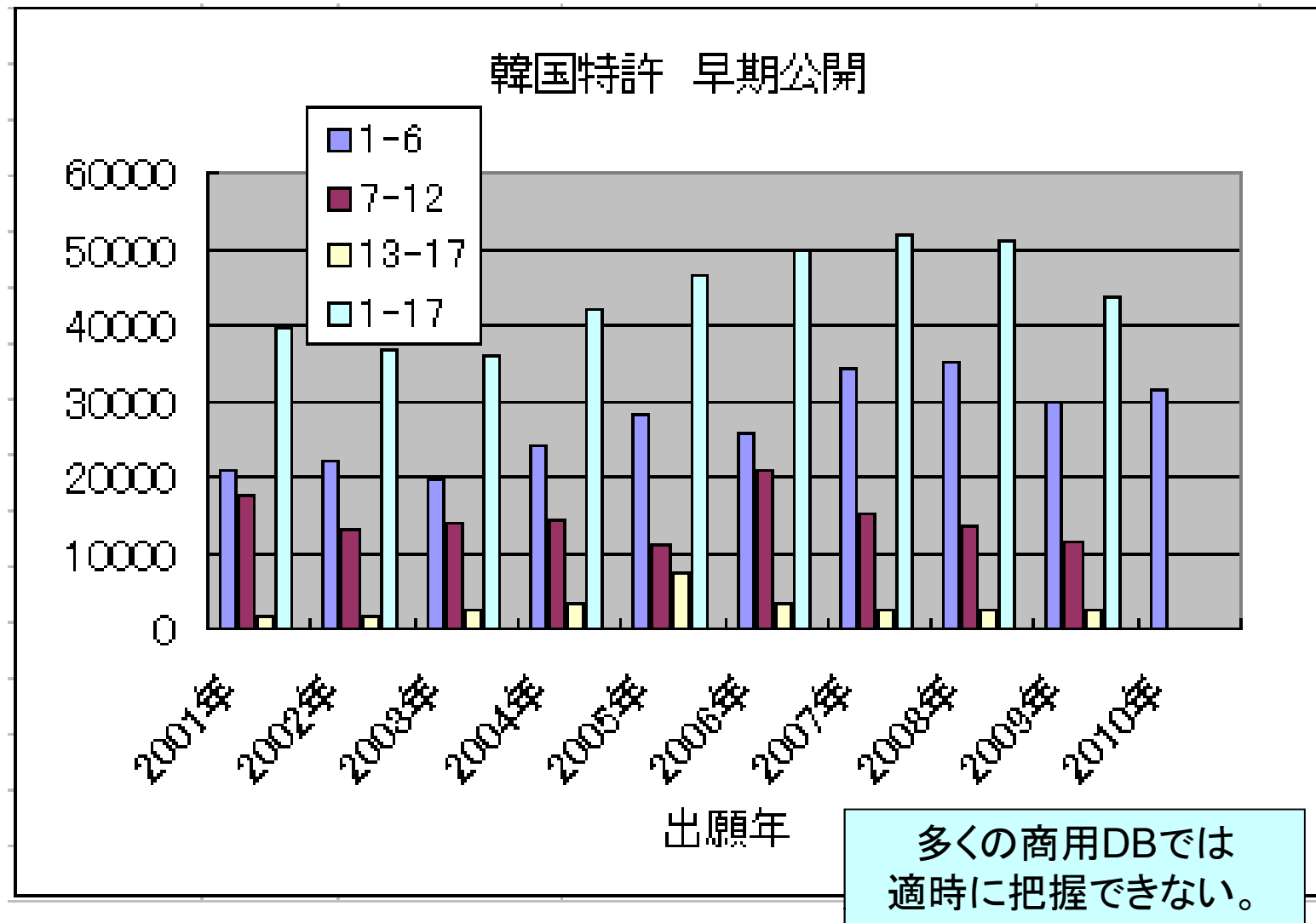
	TIPO 公告 書誌	A社 公告抄録		B社 公告抄録		C社 公告抄録		TIPO 公開 書誌	A社 公開抄録		B社 公開抄録		C社 公開抄録	
		TWB	収録率	TWB	収録率	TWB	収録率		TWA	収録率	TWA	収録率	TWA	収録率
2005	20631	20543	100%	20431	99%	20605	100%	41439	41026	99%	40490	98%	33	0%
2006	23229	22464	97%	22965	99%	22573	97%	44783	44327	99%	43828	98%	46	0%
2007	22218	22077	99%	21972	99%	22193	100%	46986	45876	98%	46018	98%	74	0%
2008	12867	11880	92%	12766	99%	9116	71%	50141	49514	99%	49338	98%	50091	100%
2009	14140	11072	78%	14010	99%	11483	81%	52618	52003	99%	51655	98%	52565	100%
2010	16345	9717	59%	16138	99%	13525	83%	44962	44536	99%	44352	99%	44926	100%
2011	20025	4440	22%	19742	99%	11938	60%	46157	45764	99%	45245	98%	43155	93%
2012/1	2066	0	0%	2062	100%	1984	96%	4232	4208	99%	4183	99%	4227	100%
2012/2	1690	0	0%	1680	99%	1624	96%	4322	4284	99%	4266	99%	4321	100%
2012/3	2048	0	0%	2038	100%	1997	98%	4256	4180	98%	4163	98%	4254	100%
2012/4	1878	0	0%	1872	100%	1822	97%	4021	3982	99%	3962	99%	4019	100%
2012/5	2123	0	0%	2108	99%	0	0%	4212	4304	102%	4146	98%	4211	100%
2012/6	2030	0	0%	2006	99%	0	0%	4789	4742	99%	4742	99%	4785	100%
2012/7	2108	0	0%	2086	99%	0	0%	5107	5045	99%	5045	99%	0	0%

商用データベースの収録(韓国)

	KIPRIS	A社		B社		C社		KIPRIS	A社		B社		C社	
	公開 書誌	公開抄録		公開抄録		公開抄録		登録 書誌	登録抄録		登録抄録		登録抄録	
		件数	収録率	件数	収録率	件数	収録率		件数	収録率	件数	収録率	件数	収録率
2005	123492	122596	99%	120991	98%	123480	100%	73873	60687	82%	69807	94%	73226	99%
2006	135946	134753	99%	133436	98%	135910	100%	120993	112604	93%	116397	96%	120678	100%
2007	122581	121009	99%	119830	98%	122541	100%	124794	122351	98%	120698	97%	124493	100%
2008	114829	113133	99%	112133	98%	114793	100%	85148	82168	97%	83074	98%	85130	100%
2009	133121	132075	99%	130871	98%	133091	100%	56814	48142	85%	54612	96%	56806	100%
2010	138946	137739	99%	136636	98%	139103	100%	68592	66987	98%	69751	102%	68588	100%
2011	140131	138512	99%	137519	98%	139970	100%	94225	63753	68%	95977	102%	94214	100%
2012/1	8629	8557	99%	8477	98%	8623	100%	8231	8197	100%	8171	99%	8978	109%
2012/2	9561	9504	99%	9412	98%	9559	100%	5069	5049	100%	5037	99%	11912	235%
2012/3	12998	12913	99%	12803	98%	12991	100%	14619	2156	15%	13527	93%	7646	52%
2012/4	10024	9951	99%	9874	99%	10021	100%	8572	6851	80%	8392	98%	8841	103%
2012/5	14131	14038	99%	13922	99%	14126	100%	10042	6558	65%	9767	97%	11370	113%
2012/6	14475	14165	98%	14335	99%	14472	100%	10481	1904	18%	10174	97%	8254	79%
2012/7	14610	13161	90%	14399	99%	14606	100%	9612	0	0%	9312	97%	9611	100%

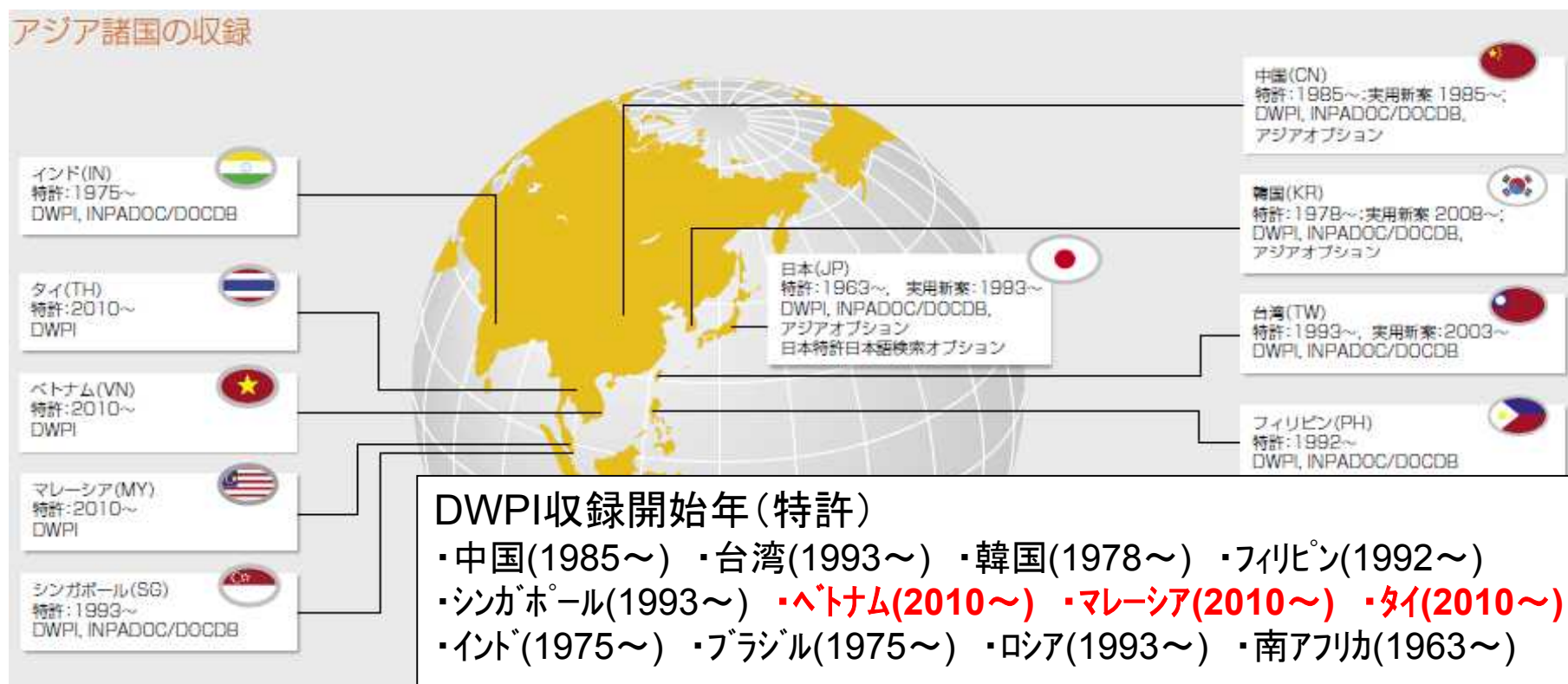
C社データは、一部
登録中に公開が混在

早期公開特許



その他のアジア・新興国の特許情報

DWPI・INPADOCの収録



http://science.thomsonreuters.jp/media/ps/wp/TI_asia_market.pdf

その他のアジア・新興国の特許情報

国名	公報タイプ	INPADOCDB		WPI	CAplus	
香港 HK	英国特許登録	HKA	1976 - 1997	—	—	
	標準特許	HKA1	1997 - 最新 2011.4.29 ⑤2-4 週間		HKA1	2000 - 最新 2011.4.29 ⑤2-4 週間
	短期特許	HKA2	1998 - 最新 2011.4.29 ⑤2-4 週間		HKA2	2000 - 最新 2011.4.29 ⑤2-4 週間
インドネシア ID	特許出願	IDA	1993 - 2002	—	—	
	特許	IDB	1996			
	簡易特許	IDS	1996, 1997, 2001			
マレーシア MY	英国輸入特許 登録特許	MYA	1953 - 1989	—	—	
	登録特許	—		MYA *1 2010.1.15 - 最新 2010.10.29 ⑤3 ヶ月以上		
フィリピン PH	公開特許 (特許出願)			PHA 1992 - 1999, 2002 - 最新 2011.3.28 ⑤3-4 週間	PHA	2006.11.20 最新 2011.5.9 ⑤なし
	登録特許	PHA	1975 - 1999	PHB 1999 - 2000	—	
				PHB1 1999 - 最新 2011.1.26 ⑤3 ヶ月以上		

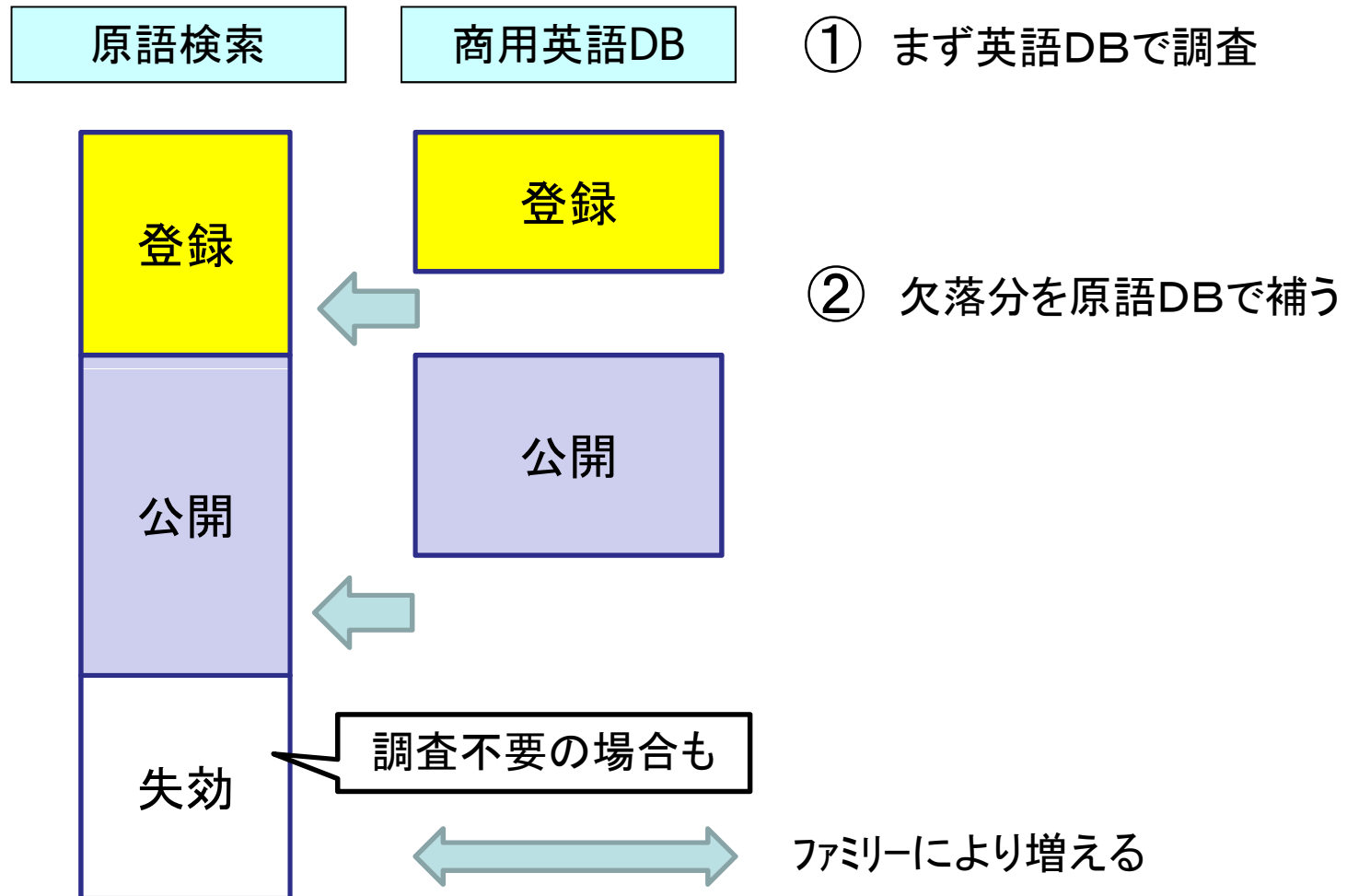
<http://www.jaici.or.jp/stn/pdf/asiapat.pdf>(化学情報協会)

その他のアジア・新興国の特許情報

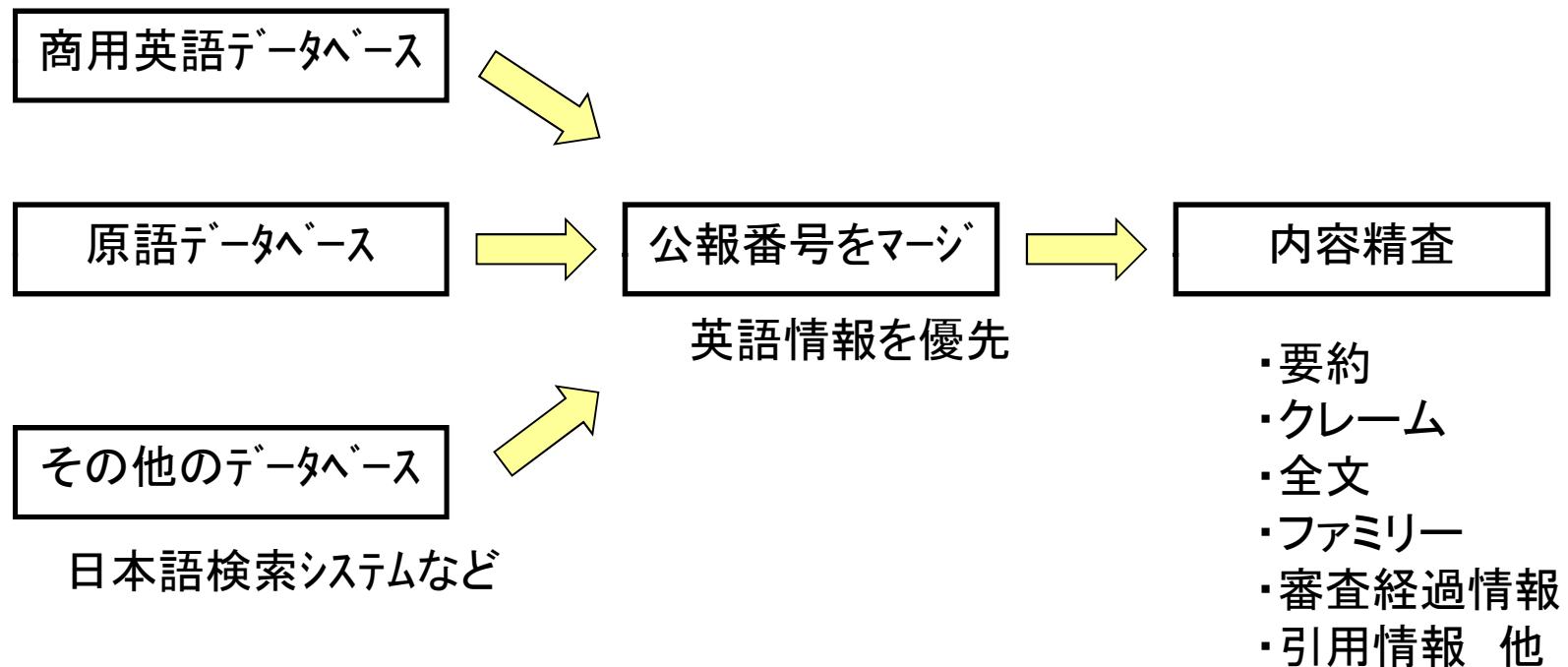
	タイ								フィリピン					
	DIP		B社						PHIL PAT	espace	A社	B社		
	公開	登録	THA			THB			書誌	PH A	PH	PH		
	書誌	書誌	書誌	抄録	収録率	書誌	抄録	収録率		書誌	書誌	書誌	抄録	収録率
1995年	2151	777	1728	1723	80%	470	469	60%	1151	2	99	99	2	0%
1996年	5410	1345	4790	4780	88%	873	872	65%	1111	165	168	164	148	13%
1997年	4659	1135	4060	4042	87%	715	711	63%	1299	785	838	830	695	54%
1998年	3931	1195	3479	3473	88%	733	733	61%	538	564	564	558	513	95%
1999年	5025	632	4577	4539	90%	404	403	64%	1201	92	92	93	83	7%
2000年	5606	752	4704	4690	84%	420	418	56%	1620	0	0	0	0	
2001年	6589	1505	4747	4732	72%	785	784	52%	2187	0	0	0		
2002年	5797	2447	4022	3998	69%	1081	1079	44%	5000	0	0	0		
2003年	5602	1909	3862	3855	69%	632	631	33%	3674	0	0	0		
2004年	5795	2049	4213	4143	71%	715	714	35%	2667	0	0	0		
2005年	8169	1306	5747	5638	69%	539	540	41%	2649	0	0	0		
2006年	7849	1880	5028	4799	61%	1119	1115	59%	4138	0	0	0		
2007年	5948	1824	3575	2956	50%	949	949	52%	3820	0	0	0		
2008年	4929	2206	2811	1313	27%	966	959	43%	5000	0	0	0		

中国、台湾、韓国、インド、ブラジル、ロシア、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、ベトナムなどの各国特許庁・商用英語DBの詳細収録情報は「知財部調査室・資料室」参照
<http://www.geocities.jp/patentsearch2006/reference-room.html>

非英語圏の特許調査の基本

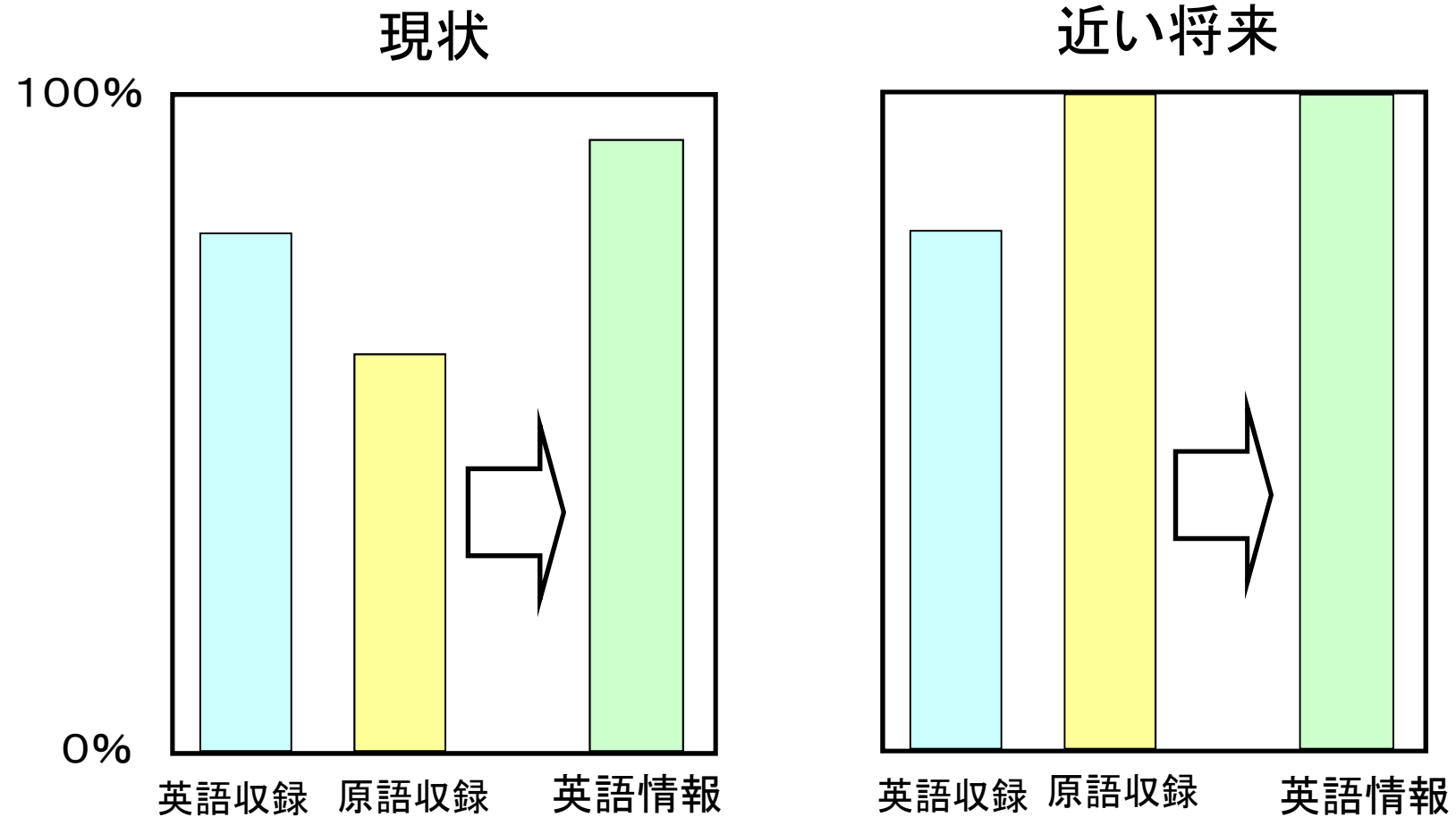


非英語圏の特許調査の基本



原語データベースは英語データベースの補完として使う。
英語データベースには、収録の漏れ、収録のタイムラグあり。

ハイブリッド検索システム(イメージ図)



英語ワードと原語ワードをシームレスに検索できる。

英中科学用語辞書(鄭州大学)

(<http://www3.zzu.edu.cn/zzjdict/>)

郑州大学在线英汉-汉英科技大词典查询结果

从固定词库中查到与所给词语“solar cell”相关的条目12条；从自定义库中查到相关条目0条（注：自定义词条之内容为网友添加，不代表本站之立场和言论）。

- calibrated solar cell 标定太阳能电池
- continuous silicon solar cell 连续硅太阳电池
- graded energy gap solar cell 分级能带宽度太阳能电池
- omnidirectional solar cell 全向太阳电池
- silicon solar cell 硅太阳电池
- solar cell 太阳电池
- solar cell array 太阳电池阵列
- solar cell paddle 太阳能电池叶片
- solar-cell 光电管
- thermoelectric solar cell 热电太阳能电池
- thin film solar cell 薄膜太阳电池
- wrap around type solar cell 卷包式太阳电池；卷包式太阳电池

英語 ⇒ 中国語

Web辞書を使う際の留意点

特許用語専門辞書ではないので
候補に挙げられた用語がデータ
ベースにあるとは限らない。
逆に特許で汎用されている用語
を示してくれないこともある。

强烈建议您使用IE 4.0以上，屏幕分辨率800X600以上，真彩，小字体浏览

繁体字同義語辞書(台湾)

(<http://twpat4.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwsyn>)

■ 同義詞查詢

 關於同義詞庫
 意見及建議

• 輸入中、英文查詢詞

查詢

清除

• 查詢模式
☒ 精確查詢 ☐ 模糊查詢

• 查詢IPC部別
☒ A部: 人類生活必需(顯示次部)
☒ B部: 作業、運輸(顯示次部)
☒ C部: 化學; 冶金; 組合技
☒ D部: 紡織; 造紙(顯示次部)
☒ E部: 固定建築物(顯示次部)
☒ F部: 機械工程; 照明; 供
☒ G部: 物理(顯示次部)
☒ H部: 電學(顯示次部)

全選

清除

■ 同義詞查詢 -- 簡目顯示

查詢結果: 共1筆, 第1/1頁, 自第1至第1筆

查詢條件: (1) TM=laser marking

回檢索畫面

本頁尾

群組同義詞

1 LASER MARKINGS (H)
LASER MARKS (B/H)
LASER MARKING (A/B/C/G/H)
LASER MARK (B/H)
雷射標記 (A/B/C/G/H)
雷射標示 (B)
雷射標印 (B)
晶片刻號 (B/H)
雷射標識 (B)

本頁首

英韓辭書(NAVER)

laser ▲

검색

영영사전

laser 레이저

LASER(Light Amplification by Stimulated Emission of

laser beam 레이저 광선

laser disc 레이저 디스크

laser eye surgery 레이저 시력 교정 수술

laser gun 레이저 건

laser jet 레이저제트,

laser pointer 레이저 포인터[지시기]

laser printer 레이저 프린터

laser surgery 레이저 수술

어장 | 작은창

Google翻訳

Предусмотрено покрытое изделие (например, солнечный элемент), которое включает в себя усовершенствованное просветляющее покрытие. Просветляющее покрытие включает в себя градиентный основной слой с переменным значением показателя преломления, предусмотренный непосредственно на стеклянной подложке и контактирующий с ней, при этом градиентный слой содержит смесь оксида кремния и оксида титана, причем больше оксида титана предусмотрено в дальней части градиентного слоя, удаленной от стеклянной подложки, чем в ближней части градиентного слоя, более близкой к стеклянной подложке; просветляющее покрытие также содержит слой, содержащий оксид кремния, расположенный поверх градиентного слоя. Изобретение обеспечивает повышение выходной мощности солнечного элемента. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

原文の言語:

ロシア語

翻訳する言語:

英語

翻訳

RU239007抄録部分の翻訳

ロシア語から英語に翻訳

Would cover the product (eg, solar cell), which includes an improved antireflection coating. Antireflection coating comprises a gradient core layer with a variable refractive index, provided directly on a glass substrate and in contact with her, with a gradient layer contains a mixture of silicon oxide and titanium oxide, titanium oxide and more than envisaged in the distant part of the gradient layer, remote from the glass substrate than in the near part of the gradient layer, closer to the glass substrate, an antireflection coating also contains a layer containing silicon oxide located on top of the gradient layer. Invention increases the output power of the solar cell. 3 H. and 17 ZP f-ly, 2 ill., 2 pi.

Googleツールバーのインストール

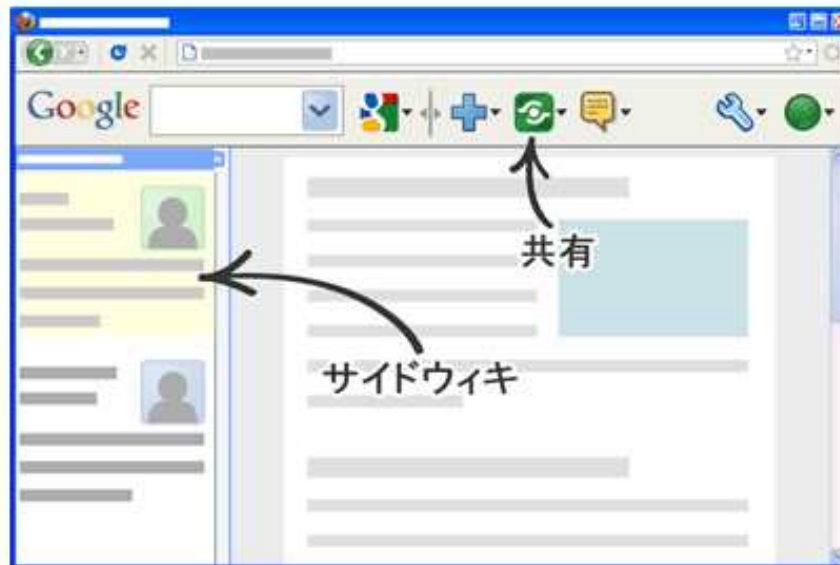
(<http://www.google.com/intl/ja/toolbar/ff/index.html>)

Google ツールバー

言語を選択  ヘルプ

Google ツールバーは [Internet Explorer](#) と [Firefox](#) でのみご利用いただけます。

New! ツールバーを使用してウェブページを共有したり、ウェブページに情報を投稿できます



インストールは数秒で完了し、無料でご利用いただけます。

Google ツールバーをインストール

[プライバシー](#) [ポリシー](#) - [以前のバージョン](#)

Firefox 2, Windows XP SP2/Vista 以上が必要です。



ウェブページを共有

ツールバーを使用してウェブページをすぐに友だちと共有できます。



役立つ情報を投稿、表示

Google サイドウィキはどのウェブページでもご利用いただけます。



ウェブページをすぐに翻訳

言語は自動的に検出されます。

イント特許庁IPAIRS検索画面

(<http://124.124.193.245/patentsearch/search/index.aspx>)

Welcome to IPAIRS Version 2.0

Granted Patents | Published Applications | Application Status | Agent Register | Allotted Examiner

Granted Patents

Submit

TITLE OF INVENTION	Containing	solar cell	AND	⏻
NOT SELECTED	Containing		AND	⏻
NOT SELECTED	Containing		AND	⏻
TITLE OF INVENTION	Containing		AND	⏻
ABSTRACT TEXT	Containing		AND	⏻
APPLICATION NUMBER	Containing		AND	⏻
APPLICANT ADDRESS	Containing		AND	⏻
NAME OF GRANTEE	Containing		AND	⏻
PATENT NUMBER	Containing		AND	⏻
DATE OF FILING(NATIONAL)	Containing		AND	⏻
INVENTOR NAME	Containing		AND	⏻
INVENTOR ADDRESS	Containing		AND	⏻
JOURNAL NUMBER(U/S 43(2))	Containing		AND	⏻
DATE OF GRANT	Containing		AND	⏻
PUBLICATION DATE	Containing		AND	⏻
INTER. CLASS. CODE(IPC)	Containing		AND	⏻
PCT INT. APPL. NUMBER	Containing		AND	⏻
NOT SELECTED	Containing		AND	⏻

マレーシア特許庁検索画面

(<https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm>)

Patent - Search		Total of 107913 application(s) found from MYIPO source.		General Guide
General Search	Advance Search	Special Search	Basket	Report
Disclaimer : The keyword 'Not' and wildcard '*' are acceptable in the search.				
Application No ?		 	AND v	
Invention Title ?	solar cell	 	AND v	
Abstract ?			AND v	
IPC No ?			AND v	
Applicant ?			AND v	
Inventor Name ?			AND v	
Agent Name ?			AND v	
Agent Country Code ?			AND v	
Legal Status ?			AND v	
Patent No ?			AND v	
PCT Application Number ?			AND v	
Priority Date	From  To 		AND v	

タイ特許庁

(<http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?lang=en>)

Complex Search

Please select source ☐ All sources

☐		DIP (THAILAND-TH)	☐		WIPO	☐		SIPO (CHINA)
☒		DIP (THAILAND-EN)	☐		EPO (EUROPEAN)	☐		IP AUSTRALIA
☐		JPO (JAPAN)	☐		USPTO (USA)	☐		
☐		KIPO (KOREA)						

Patent Type

	Fields	Comparison	Statement	Join Operator	String Comparison
☒	Abstract	like	solar cell	OR	Apart
☒	Claim	like	solar cell	AND	Apart
☐		like		AND	Apart

Order By

Additional search ☒ Synonym ☐ Acronym ☐ Homonym

Homonym condition is used in Thai person name searching only

Search Clear

Display ☒ Select all

☒ Title	☒ Abstract	☒ Claims	☒ Description	☒ Applicant	☒ Inventor	☒ Category
---	--	--	---	---	--	--

ブラジル特許庁 (<http://www.inpi.gov.br/portal/>)

Consulta à Base de Patentes

[Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: **Base Patentes** | Pesquisa Básica | Finalizar Sessão

Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

PESQUISA AVANÇADA

21)出願番号

(21) Nº do Pedido : Ex: PI0101161-8; MU6900960-0; MI5500233-1; C10201935-3.

22)出願日

(22) Data Depósito : a dd/mm/aaaa" Ex: 10/10/2001.

31)優先権番号

(31) Nº da Prioridade : Ex: 392.176

32)優先権日

Data da Prioridade : a dd/mm/aaaa" Ex: 10/10/2001

33)優先権国

País da Prioridade: « Clique e escolha »

51)IPC

(51) Classificação : H01L 31/04 Ex: G06F 13/00.

54)発明の名称

(54) Título : Ex: resfriamento and (liquido or agua) and not cruzado.

57)要約

(57) Resumo : Ex: milho and herbicida and plantas and not glifosato; carro prox(6) porta.

86)PCT出願番号

Nº do Depósito Pct: Ex: US9308239.

71/73)出願人/

権利者

Nome do Depositante : Ex: petrobras or (petroleo and brasileiro)

72)発明者

(72) Nome Inventor : Ex: "Antônio Cláudio Corêa".

Nº de Processos por Página : 20

ロシア特許庁

(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/)

Вид поиска логический ▼

Поиск

Основная область запроса

(54) Название

(11) Номер документа

(45) Опубликовано

(21) Заявка

(51) МПК **H01L31/04**

(71) Заявитель(и)

(72) Автор(ы)

(73) Патентообладатель(и)

(43) Дата публикации заявки

(85) Дата перевода заявки PCT на национальную фазу

(86) Заявка PCT

(87) Публикация PCT

Операторы
and within
or adj
not очистить

- ・要約中
- ・発明の名称
- ・公報番号
- ・発行日
- ・出願番号
- ・IPC
- ・出願人
- ・発明者
- ・権利者
- ・公開日
- ・国内移行日
- ・PCT出願番号
- ・PCT公開番号
- ・代理人
- ・先行技術文献
- ・優先権
- ・種別コード

商用DBと各国特許庁特許DB機能比較

	長所	短所
商用データベース	・隣接、近接演算、履歴演算など複雑で効率的な検索も可能。 ・独自の分類などで検索でき、データの統計処理なども可能。 ・各種の形式で結果を表示できる。 ・サポート体制が充実。	・分類など特殊なコードを使った検索は、初心者には不向き。 ・データベースによっては料金が低い。 ・アジアの特許情報は収録が不十分。
各国特許庁データベース	・データ更新が比較的早い。 ・データベースに不慣れな研究者でも手軽に検索できる。 ・公報全文や審査経過情報が入手できる。 ・無料。	・検索、出力機能に劣る。近接演算、履歴演算や絞込みなどができない。 ・テキスト検索：同義語を並べて検索要。 ・最新情報は原語検索が必要。 ・英語抄録 DB は収録が不十分。

各国特許庁データベースは、検索・出力・解析機能など商用DBに及ばないが、収録のタイムラグが短いこと、審査経過情報・年金支払情報など商用DBでは得られない情報が入手できることから、商用DBを補完するDBとして利用できる。

アジア特許情報研究会の概要

1. アジア、新興国の特許情報について研究
活動内容は、外部発表(学会、論文等)することを原則
2. 活動は毎年1月から12月
遠隔地のメンバーも考慮してワーキング内容は主として
メールでやりとり(適宜オフラインミーティング)
3. 会費は無料
4. メンバーは知財経験5年未満の方も多い。
(2012年度は28社30名)
5. 必要に応じ、商用ツールも各ベンダーさんをお願いして
無料IDを発行していただき検討しています。

2012年度活動成果をINFOPRO2012(10/18,19)で発表(6題)。
発表することもスキルの1つとして捉え、発表未経験者にも。

研究会の具体的活動

<http://www.geocities.jp/patentsearch2006/asia-research.html>

mail : patentsearch2006@yahoo.co.jp(事務局)